

PEE 5838 - Processos Avançados de Microeletrônica
Prof. Dr. A. C. Seabra

Lista 1: Litografia **Data de Entrega: 18/07/03**

1. Explique porque um processo litográfico de multicamadas potencialmente oferece maior resolução que um processo de camada única. No entanto, qual o seu inconveniente? (ilustre com diagramas das duas sequências de processamento)
2. Explique porque quanto maior o contraste de um resiste, maior a resolução dos traçados transferidos de uma máscara para a superfície de uma lâmina.
3. Calcule a distância mínima que pode ser resolvida (limite de Rayleigh) por uma lente com AN de 0,16 e:
 - a) Radiação de linha G
 - b) Radiação de linha IRepita os cálculos para lentes com AN 0,36.
4. Quantas exposições são necessárias para expor completamente o resiste em uma lâmina de 150 mm de diâmetro uma alinhadora do tipo passo-e-repetição com lente de AN 0,28 for utilizada? e se for AN 0,36?